

附表三、半導體製造與光電材料及原料製造業應定期檢測及申報之固定污染源

行業別	製程別	公告之固定污染源	條件說明	固定污染源空氣污染物檢測項目及頻率								檢測期間規範	
				揮發性有機物	三氯乙炔	氫氟酸	鹽酸	氣體組成	排放流率	檢測頻率級數	檢測頻率		檢測頻率級數調整上限
半導體製造業	各製造程序	各污染源	屬「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」之適用對象，且依照公告「公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」之附表所列相同製程條件說明者。	●	●			●	●	第三級	每年一次	得整每年次 調為二一	一、同一公私場所之固定污染源空氣污染物經密閉集氣系統，共同導入數個相同型式、規模、操作條件之污染防制設備處理，經直轄市、縣（市）主管機關核准並記載於固定污染源操作許可證及空氣污染物排放檢測計畫者，得擇一排放管道檢測，該排放管道五年內不得再為檢測。但污染防制設備後之排放管道數不足五且五年內各排放管道有例行性定期檢測申報紀錄者，不

													縣(市)主管機關通知計算調整之翌日起，經調整之固定污染源，三年內不得申請調整檢測數量。 六、前項三年之日數不累計。
光電材料及元件製造業	各製造程序	各污染源	屬「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」之適用對象，且依照公告「公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」之附表所列相同製程條件說明者。	●			●	●	第二級	每半年一次		一、每次檢測應達四小時。 二、處理效率及排放量應採濃度總平均值計算之。	
					●	●	●	●	第三級	每年一次	一、每次採樣應達三十分鐘，採樣及測定應達三次以上。 二、檢測報告應含所測得各次濃度之測值及總平均值，處理效率及排放量應採濃度總平均值計算之。		